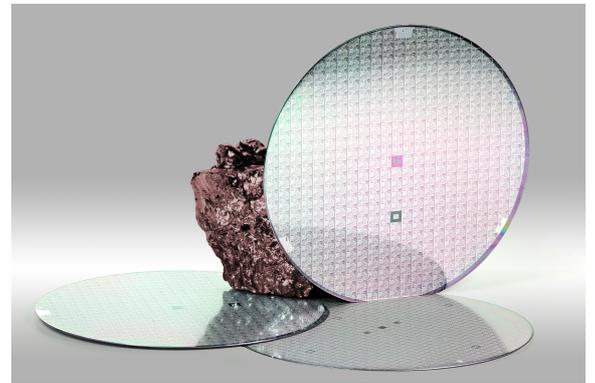


Cu(II)Oxid hochreines Metallsalz

Niedrigere Betriebskosten für die Cu-Ergänzung möglich

Die hochreinen Umicore-Kupferoxid-Metalloxidpulver werden in Übereinstimmung mit den anspruchsvollen Anforderungen der modernen advanced packaging Industrie entwickelt, hergestellt und qualitätsgeprüft. In Kombination mit dem ancossys DMR®-Konzept (Direct Metal Replenishment) ist eine Reinraumnutzung möglich, die niedrigere Betriebskosten für die Cu-Ergänzung zusammen mit einer Leistungssteigerung des Elektrolyten durch höhere Cu-Konzentrationen ermöglicht.



Vorteile

- Keine VMS erforderlich
 - H₂SO₄-Konzentration bleibt konstant. Stabiles Elektrolytvolumen, regelmäßige Ergänzung und Verwerfung von Elektrolyt nicht notwendig
 - Mehrere Sorten (4N, Packaging)
 - Vollständige Rückverfolgbarkeit, nur eine Quelle für Cu
- Kosteneffizienz
 - Reduzierung der Anlagenstillstandszeit, Unterstützung wartungsfreier Galvanisierzellen
 - 50% geringere Kosten pro kg Cu im Vergleich zu VMS
 - 15% höhere Geschwindigkeit durch höheren Cu-Gehalt (60g/l i/o 50g/l)

Anwendungen

- Halbleitertechnik



Picture: Courtesy ancossys GmbH

	Umicore CuO PG	Umicore CuO HG	Umicore CuO 4N
Application	RDL and panel level substrates	Panel substrates	Fine line RDL and Pillar
Purity	99,9 %	99,9%	99,99%
auto-dosing compatibility DMR	✓	-	✓
Dissolution speed	★	★	★★
High Speed Plating	✓	✓	✓
Clean room packed / compatibility	✓	-	✓

Ihr Ansprechpartner



Andrea Grau
 Leiterin Vertrieb Europa
 T: +49 7171 607 229
andrea.grau@eu.umicore.com